

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2007 年 4 月 19 日 (19.04.2007)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2007/043621 A1

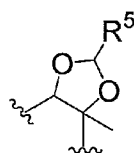
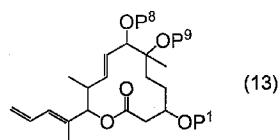
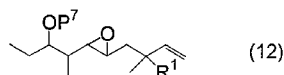
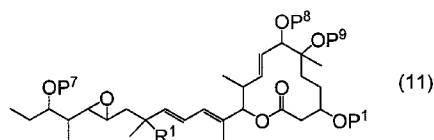
- (51) 国際特許分類:  
C07D 407/06 (2006.01) C07D 493/04 (2006.01)  
C07D 405/12 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/320405
- (22) 国際出願日: 2006 年 10 月 12 日 (12.10.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2005-299228  
2005 年 10 月 13 日 (13.10.2005) JP  
60/727845 2005 年 10 月 19 日 (19.10.2005) US
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社 (Eisai R & D Management Co., Ltd.) [JP/JP]; 〒1128088 東京都文京区小石川 4 丁目 6 番 1 0 号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): カナダ レジナ ミキエ (KANADA, Regina, Mikie) [BR/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台 5 丁目 1 番地 3 エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 伊藤 大輔 (ITO, Daisuke) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台 5 丁目 1 番地 3 エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 酒井 孝 (SAKAI, Takashi) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台 5 丁目 1 番地 3 エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 浅井 直樹 (ASAI, Naoki) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台 5 丁目 1 番地 3 エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 小竹 良彦 (KOTAKE, Yoshihiko) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台 5 丁目 1 番地 3 エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 新島 淳 (NIJIMA, Jun) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台 5 丁目 1 番地 3 エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP).

[ 続葉有 ]

(54) Title: TOTAL SYNTHESIS OF PLADIENOLIDE B AND PLADIENOLIDE D

(54) 発明の名称: プラジエノライド B 及びプラジエノライド D の全合成方法



(57) Abstract: Disclosed is a process for production of a compound represented by the formula (11): (11) [wherein  $P^1$  represents a hydrogen atom or a protective group for a hydroxyl group;  $P^7$  represents a hydrogen atom or a protective group for a hydroxyl group;  $P^8$  represents a hydrogen atom, an acetyl group or a protective group for a hydroxyl group and  $P^9$  represents a hydrogen atom or a protective group for a hydroxyl group, or  $P^8$  and  $P^9$  may together form a group represented by the formula: (where  $R^5$  represents a phenyl group which may have a halogen atom; and  $R^1$  represents a hydrogen atom or a hydroxyl group)]. The process comprises the step of reacting a compound represented by the formula (12): (12) (wherein  $P^7$  and  $R^1$  are as defined above) with a compound represented by the formula (13): (13) (wherein  $P^1$ ,  $P^8$ ,  $P^9$  and  $R^5$  are as defined above) in the presence of a catalyst.

(57) 要約: 式 (12) (式中、 $P^7$  は水素原子又は水酸基の保護基を意味する;  $R^1$  は水素原子又は水酸基を意味する) で表される化合物と、式 (13) (式中、 $P^1$  は水素原子又は水酸基の保護基を意味する;  $P^8$  は水素原子、アセチル基又は水酸基の保護基を意味する;  $P^9$  は水素原子又は水酸基の保護基を意味する; また、 $P^8$  及び  $P^9$  は一緒になって、式 (式中、 $R^5$  はハロゲン原子を有していてもよいフェニル基を意味する) で表される基を形成してもよい) で表される化合物とを、触媒の存在下に反応させることを特徴とする、式 (11) (式中、 $P^1$ 、 $P^7$ 、 $P^8$ 、 $P^9$  及び  $R^1$  は前記定義と同意義を意味する) で表される化合物の製造方法。



(74) 代理人: 浅村 皓, 外(ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒1000004 東京都千代田区大手町 2 丁目 2 番 1 号 新大手町ビル 3 3 1 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。